【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成28年2月18日(2016.2.18)

【公開番号】特開2013-140663(P2013-140663A)
【公開日】平成25年7月18日(2013.7.18)
【年通号数】公開・登録公報2013-038
【出願番号】特願2012-286539(P2012-286539)
【国際特許分類】
*Ｇ１１Ｂ　5/65　(2006.01)*
*Ｇ１１Ｂ　5/73　(2006.01)*
*Ｇ１１Ｂ　5/84　(2006.01)*
*Ｇ１１Ｂ　5/02　(2006.01)*
【ＦＩ】
Ｇ１１Ｂ　5/65
Ｇ１１Ｂ　5/73
Ｇ１１Ｂ　5/84　Ｚ
Ｇ１１Ｂ　5/02　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月25日(2015.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
磁気ストレージ媒体であって、
基板上に形成されたパターンであって、第１材料から作成された第１領域と、前記第１材料とは異なる第２材料から作成された第２領域とを有し、前記第１領域は前記第２領域に対して横方向に隣接している、パターン、
前記パターン上に形成された磁性層であって、非磁性分離体境界によって分離された磁性粒子を有し、前記磁性粒子のうち少なくとも１つは前記第１領域の上方に位置し、前記磁性粒子のうち少なくとも１つは前記第２領域の上方に位置し、前記非磁性分離体境界は前記第１領域と前記第２領域の間に規定されるエッジの上方に位置する、磁性層と、
を有する磁気ストレージ媒体。
【請求項２】
前記パターンは、複数の前記第１領域と複数の前記第２領域を有し、
各前記第１領域は、隣接する前記第２領域の間に位置する、
請求項１記載の磁気ストレージ媒体。
【請求項３】
前記パターンは、約１粒子の幅～約６粒子の幅の範囲のピッチを有する、請求項１記載の磁気ストレージ媒体。
【請求項４】
前記ピッチは、約２粒子の幅～約４粒子の幅の範囲である、請求項３記載の磁気ストレージ媒体。
【請求項５】
前記ピッチは、約３粒子の幅の範囲である、請求項３記載の磁気ストレージ媒体。
【請求項６】

磁気ストレージ媒体を製造する方法であって、
基板上に形成されるパターンのピッチを決定するステップであって、前記パターンは第１および第２特徴体を有し、個々の前記第１および第２特徴体の間に交差部が規定され、前記第１特徴体は第１材料から作成され、前記第２特徴体は前記第１材料とは異なる第２材料から作成され、前記第１特徴体は前記第２特徴体に対して横方向に隣接している、ステップ、
前記決定されたピッチを有する前記パターンに従って前記基板をパターン化するステップ、
前記基板上に磁性粒子および非磁性材料の被覆を堆積させるステップであって、前記非磁性材料は前記第１および第２特徴体の前記交差部それぞれの上方に蓄積して分離体境界を形成し、前記磁性粒子は前記分離体境界間に蓄積し、前記磁性粒子のうち少なくとも１つは前記第１特徴体の上方に位置し、前記磁性粒子のうち少なくとも１つは前記第２特徴体の上方に位置する、ステップ、
を有する方法。
【請求項７】
前記ピッチは、約２磁性粒子の幅～約６磁性粒子の幅である、請求項６記載の方法。
【請求項８】
前記ピッチは、約３磁性粒子の幅～約６磁性粒子の幅である、請求項６記載の方法。
【請求項９】
前記第１材料は磁性材料を含み、前記第２材料は非磁性材料を含む、請求項１記載の磁気ストレージ媒体。